

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 11 月 12 日 (2009.11.12)

【公表番号】特表 2007-529461 (P2007-529461A)

【公表日】平成 19 年 10 月 25 日 (2007.10.25)

【年通号数】公開・登録公報 2007-041

【出願番号】特願 2007-503290 (P2007-503290)

【国際特許分類】

C 0 7 C 67/48 (2006.01)

B 0 1 D 53/14 (2006.01)

C 0 7 C 69/82 (2006.01)

【F I】

C 0 7 C 67/48

B 0 1 D 53/14 1 0 2

C 0 7 C 69/82 A

【誤訳訂正書】

【提出日】平成 21 年 9 月 15 日 (2009.9.15)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

芳香族ジカルボン酸のジアルキルエステル A) を含有しているガス流を精製及び冷却する方法であって、

第一段階において脂肪族ジヒドロキシ化合物 B) でガス流を、ジアルキルエステル A) の融点よりも低い / 同じ温度で処理し、少なくとも 1 つの第二段階において脂肪族ジヒドロキシ化合物 B) でガス流を、ジヒドロキシ化合物 B) の融点を上回って処理し、並びに前記第一段階においてジヒドロキシ化合物 B) が 140 よりも低い / 同じ温度を有し、かつ前記第二段階において 20 ~ 80 の温度を有することを特徴とする、芳香族ジカルボン酸のジアルキルエステル A) を含有しているガス流を精製及び冷却する方法。

【請求項 2】

ジアルキルエステル A) としてテレフタル酸、イソフタル酸、2, 6 - ナフタレンジカルボン酸又はそれらの混合物のエステルを使用する、請求項 1 記載の方法。

【請求項 3】

炭素原子 1 ~ 4 個を有するアルキル基を有するジアルキルエステル A) を使用する、請求項 1 又は 2 記載の方法。

【請求項 4】

ガス流として、負荷された不活性ガス流を精製及び冷却する、請求項 1 から 3 までのいずれか 1 項記載の方法。

【請求項 5】

ジヒドロキシ化合物 B) として炭素原子 2 ~ 6 個を有するジオールを使用する、請求項 1 から 4 までのいずれか 1 項記載の方法。

【請求項 6】

ジヒドロキシ化合物 B) として 1, 4 - ブタンジオールを使用する、請求項 1 から 5 までのいずれか 1 項記載の方法。

【請求項 7】

ジアルキルエステル A) としてテレフタル酸ジメチルを使用する、請求項 1 から 6 までのいずれか 1 項記載の方法。

【請求項 8】

ジアルキルエステルに対するガス流の飽和度 [%] が 5 0 % よりも少ない / 同じである、請求項 1 から 7 までのいずれか 1 項記載の方法。

【請求項 9】

精製及び冷却後にガス流が 2 0 質量 ppm 未満の芳香族ジアルキルエステル A) を含有する、請求項 1 から 8 までのいずれか 1 項記載の方法。

【誤訳訂正 2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 1 8

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 1 8】

故に、本発明の課題は、芳香族ジカルボン酸のジアルキルエステル A) を含有しているガス流を冷却及び精製するための改善された方法を提供することであって、第一段階において脂肪族ジヒドロキシ化合物 B) でガス流を、ジアルキルエステル A) の融点よりも低い / 同じ温度で処理し、かつ少なくとも 1 つの第二段階において、脂肪族ジヒドロキシ化合物 B) でガス流を、ジヒドロキシ化合物 B) の融点を上回って処理することにより特徴付けられている。